

在先进的电弧处理和稳定的功率输出技术基础上，AE 的 Ascent® AMS 在高精度大面积镀膜应用领域取得显著的技术进步，在低功率级别上实现前所未有的功率输出精准度和稳定性。

优势

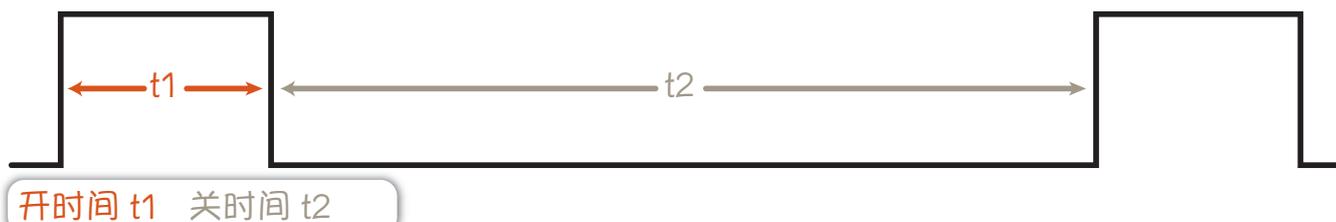
- › 高水平的镀膜质量与产量
- › 减少电弧对薄膜、基板和设备的损坏
- › 在高密度电弧情况下，保障稳定的产量和功率输出
- › 易于集成，控制灵活

特点

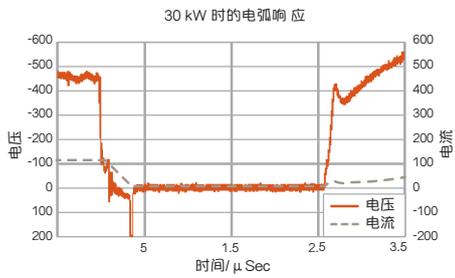
- › 精准、稳定的低功率输出
- › Arc Management System™ (AMS) 技术 — 客户可以针对金属和陶瓷靶材预设参数
- › Set point compensation™ 技术 — 稳定的产量



大面积镀膜应用的技术进步使薄膜越来越薄。由于镀膜系统主要被设计用在较高功率级别下操作，种子层和阻挡层的沉积面临技术挑战。传统的做法只是单纯降低功率级别，但这种做法往往会导致等离子体与功率输出的不稳定。借助 Ascent AMS 电源的精准数字控制系统，AE 开发出一种独有算法，实现可以在给定工艺步骤中输出精准的平均低功率。获得的结果是：Ascent AMS 电源显著提升镀膜均匀性和溅射率的稳定性。



通过使用各种用户可编程的开关时间，可以实现接近 2 kHz 的平均低功率。



Arc Management System™ (AMS) 和 Set Point Compensation™ 专利技术相结合，显著降低电弧对薄膜和设备危害，维持稳定产量

领先的电弧检测、关断和恢复速度大大
降低电弧对薄膜和设备的损害。

Set Point Compensation™ 技术通过自动调节功率输出来补偿灭弧期间功率关断造成的沉积率损失，显著改善功率输出的可重复性并维持溅射率。

